

「半導体・オブ・ザ・イヤー2023」半導体製造装置部門でグランプリを受賞
～ 3nm+ノード世代に対応したマルチ電子ビームマスク描画装置 MBM™-2000PLUS ～

このたび、当社が開発しました 3nm+ノード世代の半導体製造用マスク量産に対応したマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-2000PLUS」が、電子デバイス産業新聞主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー2023」半導体製造装置部門でグランプリを受賞しましたので、お知らせ致します。



< 「MBM™-2000PLUS」 外観 >

受賞製品である「MBM™-2000PLUS」は、3nm+デザインルール対応のマルチ電子ビームマスク描画装置で、25万本の電子ビームを高速・高精度に制御し、3nm+デザインルールのフォトマスク描画において、位置精度 1.3nm(3 σ)、寸法精度 0.65nm(3 σ)という高精度のマスク描画を実現しており、2022年より販売を開始しております。

当社グループは、今後も、最先端の半導体製造装置分野における技術開発、設計、製造、サービス業務を推進し、企業価値の更なる向上に取り組んで参ります。

以上